



UVENEL

СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Системы UVENEL УФ-отверждения предлагают комплексные решения для прогрессивных производителей интерьерной мебели из плоских заготовок (деревянные двери, столы, шкафы, полки...), а также для производителей паркета. Системы обеспечивают оптимальное сочетание лаков и эмалей, отверждаемых с помощью современных методов УФ-излучения и обеспечивающих защиту поверхностей из шпона, массивной древесины,

МДФ и различных пленок. В результате применения самых передовых технологий, деревянная мебель, окрашенная системой покрытий UVENEL, приобретает современный вид и отличную защиту. Главное преимущество систем UVENEL состоит в высокой производительности и экономичности производственного процесса вследствие высокой скорости сушки покрытия и оптимального расхода материалов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

- высокая производительность и экономичность
- низкий расход материала для данной поверхности (25% от типичного нанесения методом распыления)
- минимальные потери материала в процессе производства (до 5%, в то время как у материалов на растворителе 60%)
- низкая эмиссия ЛОС (концентрация сухого вещества = 95 -100%)
- превосходные химические и физические свойства отвержденного покрытия.



СИСТЕМЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Вид подложки и система покрытий	Наименование материала и расход	Рекомендации
Шпон и массивная древесина Прозрачная система покрытий	UVENEL Грунтовочный лак или шпатлевка (20-25 г/м ²) Гелеобразование	В зависимости от вида подложки применяются различные грунтовочные покрытия.
	UVENEL Грунтовка (15-20 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Грунтовочный лак (12-15 г/м ²) Отверждение	Отделочные покрытия различной степени блеска могут также наноситься лазерными валками (18-22 г/м ²).
	UVENEL Отделочный лак (4-5 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Отделочный лак (4-5 г/м ²) Отверждение	
МДФ Пигментированная система покрытий	UVENEL Грунтовочная эмаль или шпатлевка (25-30 г/м ²) Гелеобразование	Для качественного укрывания МДФ необходимо нанесение грунтовки в два слоя.
	UVENEL Грунтовочная эмаль (20-25 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Грунтовочная эмаль (15-18 г/м ²) Отверждение	Отделочные покрытия различной степени блеска могут также наноситься лазерными валками (18-22 г/м ²).
	UVENEL Отделочная эмаль (6-8 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Отделочная эмаль (6-8 г/м ²) Отверждение	
Пленки Прозрачная или пигментированная система покрытий	Адгезионная грунтовка на водной основе или УФ-отверждения (5-10 г/м ²) – ускоренная сушка 30 сек/60°С или УФ-сушка Гелеобразование	Адгезионная грунтовка на водной основе или УФ - отверждения используется для повышения адгезии покрытия к пленкам различного вида.
	UVENEL Грунтовочный лак/эмаль или шпатлевка (20-25 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Грунтовочный лак/эмаль (15-18 г/м ²) Отверждение	Отделочные покрытия различной степени блеска могут также наноситься лазерными валками (18-22 г/м ²).
	UVENEL Отделочный лак/эмаль (6-8 г/м ²) Гелеобразование	
	UVENEL Отделочный лак/эмаль (6-8 г/м ²) Отверждение	



ПРИМЕНЕНИЕ

- вязкость материала при поставке является его рабочей вязкостью.
- шпатлевка и грунтовка наносятся непосредственно на отшлифованную натуральную или мореную поверхность.
- для повышения адгезии покрытия к пленкам рекомендуется нанести специальную грунтовку на водной основе или грунтовку УФ-отверждения.
- для достижения качественной промежуточной адгезии отшлифовать предыдущее покрытие наждачной бумагой зернистости Р 400-500.
- укладка и упаковка деталей сразу после УФ-отверждения.

- Скорость отверждения UVENEL покрытий в УФ туннельной камере позволяет эффективно повысить производительность.
- Преимущества систем UVENEL для производителей мебели заключаются в снижении производственных затрат путем сокращения расхода и отходов материалов в процессе производства.



ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Лаковые и эмалевые покрытия УФ-отверждения высыхают/отверждаются при передвижении через туннель, оснащенный ртутными (Hg) и галлиевыми (Ga) лампами среднего давления с интенсивностью излучения 80 - 120 Вт/см.

Сушка/отверждение прозрачной системы покрытий:

- Оснащение ртутными (Hg) лампами
- Гелеобразование: одна Hg лампа (1x80 Вт/см)
- Отверждение: две Hg лампы (2x80 Вт/см)

Сушка/отверждение пигментированной системы покрытий:

- Оснащение галлиевыми (Ga) и ртутными (Hg) лампами
- Гелеобразование: одна Ga лампа (1x80 Вт/см)
- Отверждение: одна Ga лампа + одна Hg лампа (2x80 Вт/см)

Расстановка ламп:

- Ga лампа должна быть на первой позиции.
- Hg лампы должны быть на второй и третьей позициях.
- Интенсивность излучения ламп и скорость конвейера влияют на степень отверждения покрытия.
- Температура поверхности и скорость конвейера влияют на степень блеска покрытия.
- Очень важные факторы - соблюдение чистоты рефлекторов и учет срока службы ламп.





Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale
Slovenia
info@helios.si
www.helios-group.eu